



Registerauszug zum Aktenzeichen 10 2013 106 729.8

Stand am 19.05.2024
(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 09.02.2024)

Es bestehen folgende Eintragungen:

Stammdaten

- [-----] **Schutzrechtsart:** Patent
 - [-----] **Status:** Anhängig/in Kraft
 - [21] **Aktenzeichen DE:** 10 2013 106 729.8
 - [54] **Bezeichnung/Titel:** Feldeffekttransistor-Anordnung
 - [51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 29/78 (2006.01)
 - [22] **Anmeldetag DE:** 26.06.2013
 - [43] **Offenlegungstag:** 31.12.2014
 - [71/
73] **Anmelder/Inhaber:** Technische Universität Darmstadt, 64289 Darmstadt, DE
 - [-----] **Erfinder:** Schwalke, Udo, 64839 Münster, DE; Wessely, Frank, 64807 Dieburg, DE; Krauss, Tillmann, 63150 Heusenstamm, DE;
 - [74] **Vertreter:** Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB, 64293 Darmstadt, DE
 - [10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE102013106729A1
 - [-----] **Zustellanschrift:** Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB, 64293 Darmstadt, DE
 - [-----] **Inländische Priorität beansprucht in:** PCT/EP2014/063459
 - [-----] **Fälligkeit:** Jahresgebühr für das 12. Jahr/ 30.06.2024
 - [-----] **Zuständige Patentabteilung:** 33
 - [56] **Entgegenhaltungen/Zitate:** US020020009833A1 (US 2002 / 0 009 833 A1); US020050092985A1 (US 2005 / 0 092 985 A1); US020120056258A1 (US 2012 / 0 056 258 A1)
 - [56] **Entgegenhaltungen/Zitate NPL:** Akio Shima et al: „Metal Schottky Source/Drain Technology
-

for Ultrathin Silicon-on-Thin-Box Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors“ . In: Japanese Journal of Applied Physics , 2011, 50 04DC06. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Akio+shima++Metal+schottky+source%2FDrain+> [abgerufen am 08.02.2024]

[43] **Erstveröffentlichungstag:** 31.12.2014

[-----] **Anzahl der Bescheide:** 1

[-----] **Anzahl der Erwiderungen:** 0

[-----] **Erstmalige Übernahme in DPMAregister:** 31.12.2014

[-----] **Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister:** 31.12.2014; 25.03.2015; 20.05.2015; 01.04.2016; 12.04.2017; 05.07.2018; 11.07.2019; 10.06.2020; 30.06.2020; 17.11.2020; 01.07.2021; 09.07.2022; 30.06.2023; 09.02.2024

Verfahrensdaten

Vorverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung befindet sich in der Vorprüfung

[-----] **Verfahrensstandstag:** 26.06.2013

Vorverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Das Vorverfahren ist abgeschlossen

[-----] **Verfahrensstandstag:** 08.08.2013

Publikationen

[-----] **Verfahrensart:** Publikationen

[-----] **Verfahrensstand:** Offenlegungsschrift

[-----] **Verfahrensstandstag:** 31.12.2014

[-----] **Heftnummer:** 53

[-----] **Jahr:** 2014

[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 31.12.2014

[-----] **Publikationsart:** Schriften

[-----] **Teil:** Teil 2

[10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE102013106729A1

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsantrag wirksam gestellt

[-----] **Verfahrensstandstag:** 29.05.2020

[-----] **Heftnummer:** 29

[-----] **Jahr:** 2020

[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 16.07.2020

[-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten

[-----] **Teil:** Teil 2

[-----] **Antrag Dritter:** Nein

[-----] **Eingangstag:** 29.05.2020

Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren

[-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsbescheid

[-----] **Verfahrensstandstag:** 08.02.2024

[-----] **Tag der Aktualisierung des Verfahrens:** 09.02.2024